⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-81277

(s) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989) 3月27日

H 01 L 33/00

A - 7733 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

半導体発光素子 **砂発明の名称**

> 创特 昭62-236137

砂出 昭62(1987) 9月22日

砂発 明 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究 **田** . 康

所内

②発 正

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1

株式会社東芝総合研究

所内

包出 東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 則近 20代 理 人 憲佑 外1名

半導体発光囊子

2. 特許請求の範囲

第 1 導 観 型 の 半 導 体 基 板 上 に 、 第 1 導 電 型 のパッファ形、第2導用型のクラッド層、第2 溥 低型 の 活 性 附 、 第 1 導 低 型 の ク ラ ッ ド 層 及 び 第1選阻型のコンタクト層が順次成長形成され、 前記コンタクト層上の全面にオーミック電極が 形成され、前配半導体基板の一部に前配第2導 低型クラッド層までエッチング除去されて光取 り出し窓が形成され、この光取り出し窓を有す る半導体基板に第2導性型の不純物を拡散した 拡散領域が形成され、光取り出し窓を有する半 海体基板上にオーミック電極が形成されている ことを特徴とする半導体発光電子。

3. 発明の辞細な説明

(発明の目的)

(産築上の利用分野)

本発明は半導体発光紫子に関する。

(従来の技術)

半導体発光器子、例えば発光ダイオ 光通信システムの光源として重要である。発光ダ イオードの光通信用光源としての利点は、安価で あること、信頼性に優れていること等がある。従 来、光通信用光源としての発光ダイオードは、例 えば、第2図に示すように、広い禁止帯幅をもつ N型 GaAlAs厚膜の半導体層21上にN型GaAlAs クラッド層22、発光領域となるP型GaAs舌 性層23、及びP型GaAlAs クラッド層24を 成長し、その後世流狭窄用の絶縁膜SiO。25が 形成され、オーミック電極26,27が形成され た楞澄であった。この構造において、オーミック 電極26,27の形成時に、両面マスク合せが必 要となり、製造工程が複雑であること、ファイベ 結合効率を高めるため発光径を小さくするには、 10個径を小さくする必要があり、そのためコンタ クト抵抗が大きくなる等の問題があった。

(発明が解決しょうとする問題点)

本発明は、上に述べた問題点を解決し、製造

工程が簡単で、コンタクト抵抗の小さな半導体発 光気子を提供することにある。

〔発明の構成〕

(問題点を解決するための手段)

(作用)

光取り出し窓と発光領域を自動的に一致させることができ、製造工程が簡単になり、コンタクト居上全面にオーミックは極を形成するため、コンタクト抵抗を低減できる。

明は、上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して 実施可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例の発光ダイオードの断面図、第2図は従来の発光ダイオードの断面図である。

- 1 ··· N 亞 G a A s 基板、
- 2 ··· N 型 G a A 5 パッファ所、
- 3 ··· P型GaA&A & クラッド層、
- 4 ··· P 型 G a A s 活性 B、
- 5 ··· N 型 C a A l A s ク ラ ッ ド 層 、
- 6 ··· N 刑 G a A s コンタクト 樹、
- 7···N型オーミック電極、
- 8 … P 取オーミック性極、
- 9 ··· P 型不純物拡散铅域、
- 10 … 光取り出し窓、
- 21 ··· N 殼 G a A & A s 以 膜 陷、
- 22 ··· N 型 G a A l A s クラッド 層、
- 23 ··· P 型 G a A s 括性 的、

(实施例)

次に、図面を参照しながら、本発明を解細に 説明する。第1図は、本発明の実施例の発光ダイ オードの構造を示す断面図である。本発明の発光 ダイオードは、N型 Ga A s 基板 1 、N型 Ga A s バ ッファ暦 2 、P型 Ga A l A s クラッド 刷 3、P 型 G a A s 活性層 4 、N型 Ga A l A s クラッド 刷 5、N型 Ga A s コンタクト 層 6 、N型 オーミック 電板 7 、 P 型オーミック電極 8 、P 型 不純物拡散 領域 9 、 及び光取り出し窓 1 0 より構成されている。 N型 Ga A s 基板 1 が、電流 狭窄となる構造であり、拡 散気域 9 が電流 過路となるため発光領域 1 1 と光 取り出し窓 1 0 が自動的に一致する構造である。

〔 発明 の 効果 〕

本発明により、N型オーミック電極7とP型オーミック電極8を小さくする必要がなく、コンタクト抵抗を抵減でき、発光領域11と光取り出し際10を自動的に一致して構成できるため、両面マスク合せ等の複雑な製造工程を経ることなる。なお、本発

24 ··· P 型 G a A & A & クラッド 層、

25 ··· 8 i 0 s 絶 級 膜 、

26 ··· P 類 オーミック質 極、·

27 ··· N型オーミック独極。

特開昭64-81277 (3)



